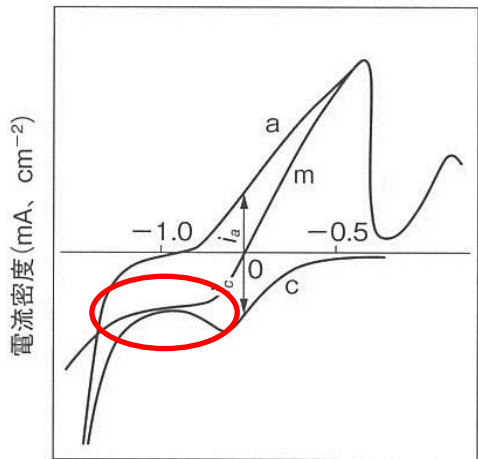
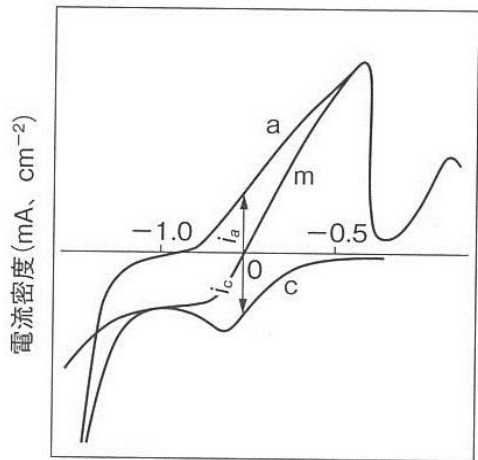


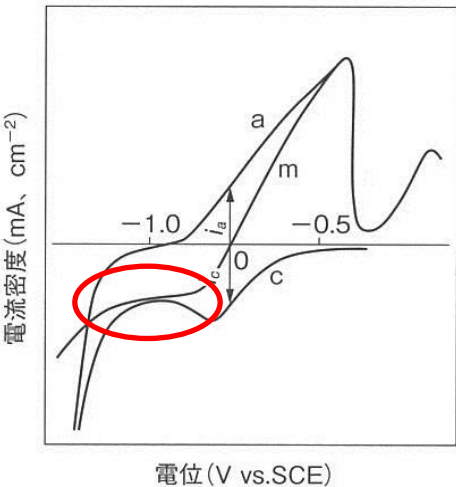
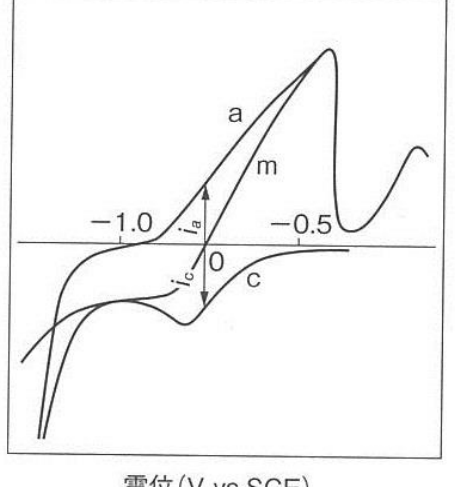
本書に誤記がありました。お詫びして訂正いたします。

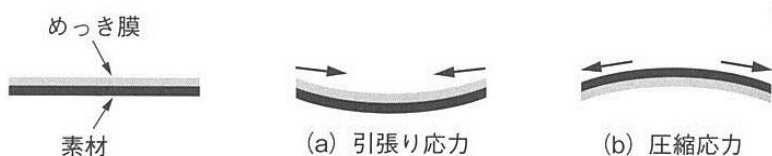
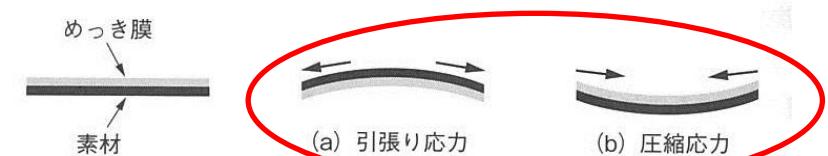
【初版2刷】

ページ数	個所・内容	誤	正
3	下から2行目	6.3 排水処理	6.3 排液処理
100	<p>図2.1 c曲線とm曲線は 交差する</p>	 <p>電流密度 (mA, cm⁻²)</p> <p>電位 (V vs. SCE)</p> <p>図2.1 無電解めっきの局部電池モデル</p> <p>a : 局部アノード分極曲線 c : 局部カソード分極曲線 m : 外部分極曲線</p>	 <p>電流密度 (mA, cm⁻²)</p> <p>電位 (V vs. SCE)</p> <p>図2.1 無電解めっきの局部電池モデル</p> <p>a : 局部アノード分極曲線 c : 局部カソード分極曲線 m : 外部分極曲線</p>
388	節タイトル	6.3 排水処理	6.3 排液処理

【初版1刷】

ページ数	個所・内容	誤	正
1	一番下	著者一同	高井 治
3	下から2行目	6.3 排水処理	6.3 排液処理
4	執筆者一覧 下から6行目	平野 満大	山本 智之
4	執筆者一覧 下から3行目	渡邊 健治	渡邊 健治

100	<p>図2.1 c曲線とm曲線は 交差する</p>	 <p>電流密度 (mA, cm⁻²)</p> <p>電位 (V vs.SCE)</p> <p>図 2.1 無電解めっきの局部電池モデル</p> <p>a : 局部アノード分極曲線 c : 局部カソード分極曲線 m : 外部分極曲線</p>	 <p>電流密度 (mA, cm⁻²)</p> <p>電位 (V vs.SCE)</p> <p>図 2.1 無電解めっきの局部電池モデル</p> <p>a : 局部アノード分極曲線 c : 局部カソード分極曲線 m : 外部分極曲線</p>
100	本文10行目	$W = Xi_0 = 1.185 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1})$	$W = Xi_0 = 1.185i_0 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1})$
122	本文下から3行目	as plate (めっき直後)	as plated (めっきのまま)
124	本文下から7行目	as plate	as plated
124	本文下から5行目 文章追記	表2.9に示す。	表2.9に示す。(表中のNo.1~4のpH調整剤は、水酸化ナトリウムでも可。)
129	本文14行目	as palte	as plated
138	本文1行目	日常	通常
141	本文1行目	触媒金属との置換反応であるために、	触媒金属金イオンとの置換反応であるために、
141	本文下から7行目 参考文献No.の追記	(TMAB)を用い、	(TMAB)を用い1)、 ※1)は上付き
145	本文下から6行目 参考文献No.の追記	チオ尿素(文献)やアスコルビン酸(文献)、	チオ尿素2)や、アスコルビン酸3)、 ※2)、3)は上付き
154	本文5~6行目 参考文献No.の追記	無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセスが適用されている。	無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセスが適用されている4)。 ※4)は上付き

156	本文下から4行目以降 157ページの文章一部 を156ページへ移動	解が生じやすくなる。そのために、無電解白金めっきはバッチ処理で使用されている。 最近では、中性領域(pH7.0~8.0)で操作する…	解が生じやすくなる。そのために、無電解白金めっきはバッチ処理で使用されている。 <ul style="list-style-type: none"> ・白金塩 各種白金(ⅡもしくはⅣ)アンミン塩 ・錯化剤 アンモニア、エチレンジアミン ・緩衝剤 各種無機酸塩、各種有機酸塩 ・還元剤 ヒドラジン、水素化ホウ素ナトリウム ・安定剤 鉛、タリウム、硫黄化合物 ・浴pH 10.0以上 ・浴温度 50~60℃ 最近では、中性領域(pH7.0~8.0)で操作する…
157	本文1行目 参考文献No.の追記	浴安定性に優れていることが報告されている。	浴安定性に優れていることが報告されている5)。 ※5)は上付き
158	本文5行目 参考文献No.の追記	これは、めっき反応時に発生する水素ガスに起因する。	これは、めっき反応時に発生する水素ガスに起因する6)。 ※6)は上付き
158	2.4節末 参考文献の追記		参考文献 1) 渡辺秀人 ; 表面技術, Vol. 53, No. 1, p. 22 (2002) 2) 井上隆史 ; 表面技術, Vol. 52, No. 5, p. 410 (2001) 3) 加藤 勝, 新倉恵子, 星野重孝, 大野 淳 ; 表面技術, Vol. 42, No. 7, p. 729 (1991) 4) 渡辺秀人 ; 表面技術, Vol. 55, No. 10, p. 651 (2004) 5) 加藤友人, 寺島 肇, 渡辺秀人, 本間英夫, 高井 治 ; 表面技術協会 第133回講演大会要旨集 p. 116 (2016) 6) 久永尚哉, 福室直樹, 八重真治, 松田 均 ; 表面技術, Vol. 63, No. 9, p. 596 (2012)
194	図3.4 (a)と(b)の図を入れ 替え	 <p>めっき膜 素材 (a) 引張り応力 (b) 圧縮応力 図3.4 引張り応力と圧縮応力</p>	 <p>めっき膜 素材 (a) 引張り応力 (b) 圧縮応力 図3.4 引張り応力と圧縮応力</p>
321	本文16~17行目	1980年代からである。デジタル機器の出現・普及期であり以来、現在まで	1980年代のデジタル機器の出現・普及期である。以来、現在まで
321	本文下から10行目 「要求は」削除	高速移動により、 <u>要求は</u> 今後も対策要求は高まる傾向にある。	高速移動により、今後も対策要求は高まる傾向にある。
324	本文7行目	ドライ成膜(蒸着)、溶射、導電性塗料も無電解	ドライ成膜(蒸着)、溶射、導電性塗料、無電解
324	本文9行目 読点の追記	形状への対応とそれによるシールド効果の	形状への対応と、それによるシールド効果の
324	本文下から3行目	酸化防止目的でニッケルをめっきするが、一般的な	酸化防止目的でニッケルをめっきするのが、一般的な
326	本文3行目	(5)おわりに	(6)おわりに

384	本文下から8行目以降	果を比べることから始める。浴管理の場合には、事前に考えられる不良原因でハルセルを取ること、不良発生時に…	果を 比較 することから始める。浴管理の場合には、事前に考えられる不良原因を含む 不調液 のハルセルを取 っておく ことで、不良発生時に…																														
384	本文下から2行目以降	す。また表6.3に基本実験条件を… 格子を移りこむようにして撮影したものである。	す。 全電流3A無攪拌 で5分間 めっき した。また表6.3に基本実験条件を… 格子の 影 を移りこむようにして撮影したものである。																														
386	表6.3	<p>表6.3 浴組成およびハルセル試験条件</p> <table border="1" data-bbox="762 369 1182 606"> <tr> <td>めっき浴種</td> <td>ワット浴</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>浴温 (°C)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>全電流 (A)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>めっき時間 (分)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>攪拌</td> <td>なし</td> </tr> </table>	めっき浴種	ワット浴	pH	4	浴温 (°C)	50	全電流 (A)	3	めっき時間 (分)	5	攪拌	なし	<p>表6.3 ハルセル試験条件</p> <table border="1" data-bbox="1586 353 2417 633"> <tr> <td>実験目的</td> <td>浴組成の変化の確認</td> <td>金属不純物の確認</td> </tr> <tr> <td>めっき浴種</td> <td colspan="2">ワット浴</td> </tr> <tr> <td>浴温</td> <td colspan="2">50°C</td> </tr> <tr> <td>めっき時間</td> <td colspan="2">5分</td> </tr> <tr> <td>全電流</td> <td>3A</td> <td>1A</td> </tr> <tr> <td>攪拌</td> <td>なし</td> <td>あり</td> </tr> </table>	実験目的	浴組成の変化の確認	金属不純物の確認	めっき浴種	ワット浴		浴温	50°C		めっき時間	5分		全電流	3A	1A	攪拌	なし	あり
めっき浴種	ワット浴																																
pH	4																																
浴温 (°C)	50																																
全電流 (A)	3																																
めっき時間 (分)	5																																
攪拌	なし																																
実験目的	浴組成の変化の確認	金属不純物の確認																															
めっき浴種	ワット浴																																
浴温	50°C																																
めっき時間	5分																																
全電流	3A	1A																															
攪拌	なし	あり																															
388	節タイトル	6.3 排水処理	6.3 排 液 処理																														